

ー装置・材料のイノベーションをアピールする新たな技術セッションー
SEMI Forum Japan 2010
テクノロジーイントロダクションセッション レポート

開催実績

参加企業数： 10 社
聴講者数： 約 80 名

概要

日時： 2010年6月1日(火) 13:40-17:00
会場： グランキューブ大阪(大阪国際会議場)
チェア： (株)リコー 電子デバイスカンパニー 新規技術開発室 シニアスペシャリスト 佐藤 裕彦
東京エレクトロン AT(株) MEMS 技術部 部長 大麻 隆彦
アジェンダ： 「東成エレクトロビームの会社概要及び各種加工事例紹介」 東成エレクトロビーム(株)
「超厚膜熱酸化膜形成技術の紹介」 ケイ・エス・ティ・ワールド(株)
「SiC ウエハー用高温イオン注入装置の紹介」 日新イオン機器(株)
「半導体製品に使用される石英冶具の再生」 江信特殊硝子(株)
「真空排気ラインの改善ツールのご紹介」 日総工産(株)
「高熱伝導グラファイトの大型ブロックと応用」 (株)サーモグラフィティクス
「生体情報センシングシステム向き ASIP」 エイシップ・ソリューションズ(株)
「半導体業界向けのソフトウエア・システム開発をベトナムでオフショア化」
グローバル・サイバーソフト・ジャパン(株)
「プラス ONE で MEMS 市場に挑戦！」 (株)インターテック
「重要性を増す半導体技術者の育成」 (株)システム LSI センター

参加者の声

- ・ 専門分野だけでなく、幅広い視野で技術に触れることができた。
- ・ 今まで知らなかった技術を知ることができ、また、日本の企業の技術の高さを再認識することができた。
- ・ 精度の高い技術を多く聞くことができ、研究に役立つ話も聞け、大変勉強になった。
- ・ 企業独自の技術説明が聞けて大変勉強になった。
- ・ 興味深い会社が多く、非常に面白かった。



お問合せ：SEMI ジャパン プログラム部

Tel : 03-3222-5993 E-mail : jeventinfo@semi.org

URL : www.semi.org